

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012年8月23日(23.08.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/111183 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) *H05K 3/28* (2006.01)
G03F 7/075 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/064778
- (22) 国際出願日: 2011年6月28日(28.06.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-028925 2011年2月14日(14.02.2011) JP
特願 2011-074888 2011年3月30日(30.03.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 積水化学工業株式会社 (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5308565 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 中村 秀 (NAKAMURA, Shigeru) [JP/JP]; 〒6180021 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP). 上田 倫久 (UEDA, Michihisa) [JP/JP]; 〒6180021 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP). 鹿毛 崇至 (KAGE, Shuuji) [JP/JP]; 〒6180021 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社内

Osaka (JP). ▲高▼橋 駿夫 (TAKAHASHI, Toshio) [JP/JP]; 〒6180021 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP). 渡邊 貴志 (WATANABE, Takashi) [JP/JP]; 〒6180021 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人 宮▲崎▼・目次特許事務所 (MIYAZAKI & METSUGI); 〒5400028 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通F Nビル Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

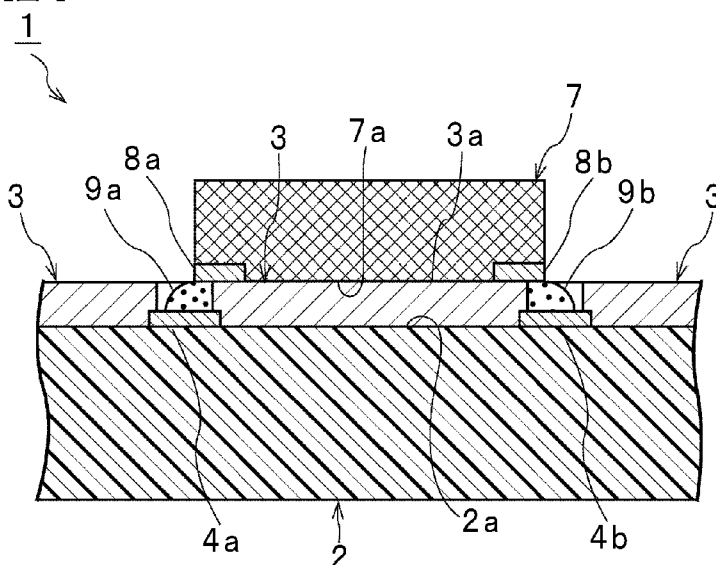
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ

[続葉有]

(54) Title: PHOTSENSITIVE COMPOSITION AND PRINTED CIRCUIT BOARD

(54) 発明の名称: 感光性組成物及びプリント配線板

[図1]



(57) Abstract: Provided is a photosensitive composition having superior repellence characteristics and defoaming characteristics when coated onto a member to be coated. The photosensitive composition contains: a polymeric polymer having a carboxyl group; a photoinitiator; titanium oxide; a first silica; a second silica; and polydimethylsiloxane. The primary particle size of the first silica is 5-100 nm inclusive. The primary particle size of the second silica is 0.5-10 μm inclusive. The photosensitive composition has a viscosity ratio (η_1/η_{10}) of at least 1.1 when the viscosity (mPa·s) at 25°C at a shear velocity of 1 rpm is η_1 and the viscosity (mPa·s) at 25°C at a shear velocity of 10 rpm is η_{10} .

(57) 要約: 塗工対象部材上に塗工されたときに、消泡性及びハジキ特性に優れている感光性組成物を提供する。本発明に係る感光性組成物は、カルボキシル基を有する重合性重合体と、光重合開始剤と、酸化チタンと、第1のシリカと、第2のシリカと、ポリジメチルシロキサンとを含む。上記第1のシリカの一次粒径は5 nm以上、100 nm以下である。上記第2のシリカの一次粒径は0.5 μm 以上、10 μm 以下である。本発明に係る感光性組成物では、せん断速度1 rpmにおける25°Cでの粘度 (mPa·s) を η_1 とし、せん断速度10 rpmにおける25°Cでの粘度 (mPa·s) を η_{10} としたときに、粘度比 (η_1/η_{10}) が1.1以上である。

0 nm以下である。上記第2のシリカの一次粒径は0.5 μm 以上、10 μm 以下である。本発明に係る感光性組成物では、せん断速度1 rpmにおける25°Cでの粘度 (mPa·s) を η_1 とし、せん断速度10 rpmにおける25°Cでの粘度 (mPa·s) を η_{10} としたときに、粘度比 (η_1/η_{10}) が1.1以上である。

WO 2012/111183 A1



(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：感光性組成物及びプリント配線板

技術分野

[0001] 本発明は、基板上に形成させるソルダーレジスト膜や、発光ダイオードチップが搭載される基板上に形成される光を反射させるレジスト膜などのレジスト膜を形成するために好適に用いられる感光性組成物、並びに該感光性組成物を用いたプリント配線板に関する。

背景技術

[0002] プリント配線板を高温のはんだから保護するための保護膜として、ソルダーレジスト膜が広く用いられている。

[0003] また、様々な電子機器用途において、プリント配線板の上面に発光ダイオード（以下、LEDと略す）チップが搭載されている。LEDから発せられた光の内、上記プリント配線板の上面側に到達した光も利用するために、プリント配線板の上面に白色ソルダーレジスト膜が形成されていることがある。この場合には、LEDチップの表面からプリント配線板とは反対側に直接照射される光だけでなく、プリント配線板の上面側に到達し、白色ソルダーレジスト膜により反射された反射光も利用できる。従って、LEDから生じた光の利用効率を高めることができる。

[0004] 上記白色ソルダーレジスト膜を形成するための材料の一例として、下記の特許文献1には、エポキシ樹脂と加水分解性アルコキシシランとの脱アルコール反応により得られたアルコキシ基含有シラン変性エポキシ樹脂を含有し、かつ不飽和基含有ポリカルボン酸樹脂と、希釈剤と、光重合開始剤と、硬化密着性付与剤とをさらに含有するレジスト材料が開示されている。

[0005] 下記の特許文献2には、芳香環を有さないカルボキシル基含有樹脂と、光重合開始剤と、エポキシ化合物と、ルチル型酸化チタンと、希釈剤とを含有する白色ソルダーレジスト材料が開示されている。

先行技術文献

特許文献

[0006] 特許文献1：特開 2 0 0 7 - 2 4 9 1 4 8 号公報

特許文献2：特開 2 0 0 7 - 3 2 2 5 4 6 号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0007] 基板上にレジスト膜を形成するために、特許文献 1 ～ 2 に記載のような従来のレジスト材料を基板上や基板上の P E T フィルム上に塗工した場合には、レジスト材料中に泡が含有され、該泡が消えずに硬化したレジスト膜中に残存することがある。すなわち、従来のレジスト材料では、消泡性が低いことがある。

[0008] さらに、従来のレジスト材料を基板上に塗工した場合には、レジスト材料のハジキ特性が低く、レジスト材料が意図しない領域に配置されることがある。

[0009] 本発明の目的は、塗工対象部材上に塗工されたときに、消泡性及びハジキ特性に優れている感光性組成物、並びに該感光性組成物を用いたプリント配線板を提供することである。

課題を解決するための手段

[0010] 本発明によれば、カルボキシル基を有する重合性重合体と、光重合開始剤と、酸化チタンと、第 1 のシリカと、第 2 のシリカと、ポリジメチルシロキサンとを含み、上記第 1 のシリカの一次粒径が 5 n m 以上、1 0 0 n m 以下であり、上記第 2 のシリカの一次粒径が 0 . 5 μ m 以上、1 0 μ m 以下であり、せん断速度 1 r p m における 2 5 $^{\circ}$ C での粘度 (m P a $\cdot$ s) を η 1 とし、せん断速度 1 0 r p m における 2 5 $^{\circ}$ C での粘度 (m P a $\cdot$ s) を η 1 0 としたときに、粘度比 (η 1 / η 1 0) が 1 . 1 以上である、感光性組成物が提供される。

[0011] 本発明に係る感光性組成物のある特定の局面では、フェノール系酸化防止剤がさらに含まれている。

[0012] 本発明に係る感光性組成物の他の特定の局面では、感光性組成物 100 重量%中の上記第 1 のシリカの含有量（重量%）を C 1 とし、感光性組成物 100 重量%中の上記第 2 のシリカの含有量（重量%）を C 2 としたときに、含有量比（C 1 / C 2）が 0.1 以上、1 以下である。

[0013] 本発明に係る感光性組成物は、ソルダーレジスト組成物として好適に用いられる。本発明に係る感光性組成物は、ソルダーレジスト組成物であることが好ましい。

[0014] 本発明に係るプリント配線板は、回路を表面に有するプリント配線板本体と、該プリント配線板本体の回路が設けられた表面に積層されたソルダーレジスト膜とを備えており、該ソルダーレジスト膜が本発明に従って構成された感光性組成物を用いて形成されている。

発明の効果

[0015] 本発明に係る感光性組成物は、カルボキシル基を有する重合性重合体と、光重合開始剤と、酸化チタンと、一次粒径が 5 nm 以上、100 nm 以下である第 1 のシリカと、一次粒径が 0.5 μ m 以上、10 μ m 以下である第 2 のシリカと、ポリジメチルシロキサンとを含み、更に感光性組成物における上記粘度比（ η_1 / η_{10} ）が 1.1 以上であるので、本発明に係る感光性組成物が塗工対象部材上に塗工されたときに、消泡性を高めることができ、かつハジキ特性を良好にすることができる。

図面の簡単な説明

[0016] [図1]図 1 は、本発明の一実施形態に係る感光性組成物を用いたレジスト膜を有する LED デバイスの一例を模式的に示す部分切欠正面断面図である。

発明を実施するための形態

[0017] 以下、本発明を詳細に説明する。

[0018] 本発明に係る感光性組成物は、カルボキシル基を有する重合性重合体（A）と、光重合開始剤（B）と、酸化チタン（C）と、第 1 のシリカ（D 1）と、第 2 のシリカ（D 2）と、ポリジメチルシロキサン（E）とを含む。上記第 1 のシリカ（D 1）の一次粒径は 5 nm 以上、100 nm 以下である。

上記第2のシリカ(D2)の一次粒径は $0.5\mu\text{m}$ 以上、 $10\mu\text{m}$ 以下である。本発明に係る感光性組成物のせん断速度 1rpm における 25°C での粘度($\text{mPa}\cdot\text{s}$)を η_1 とし、せん断速度 10rpm における 25°C での粘度($\text{mPa}\cdot\text{s}$)を η_{10} としたときに、本発明に係る感光性組成物における粘度比(η_1/η_{10})は 1.1 以上である。

[0019] 本発明に係る感光性組成物における上記構成の採用により、基板などの塗工対象部材上に感光性組成物を塗工したときに、感光性組成物の消泡性が良好になる。この結果、本発明に係る感光性組成物により形成されたレジスト膜などの硬化物膜中に、泡が含まれ難くなり、かつボイドが生じ難くなる。この結果、本発明に係る感光性組成物を用いたプリント配線板などの各種の電子部品の信頼性を高めることができる。

[0020] さらに、本発明に係る感光性組成物における上記構成の採用により、基板などの塗工対象部材上に感光性組成物を塗工したときに、感光性組成物のハジキが生じ難くなる。この結果、本発明に係る感光性組成物により形成されたレジスト膜などの硬化物膜が、意図しない領域に配置され難くなる。このため、本発明に係る感光性組成物を用いたプリント配線板等の電子部品の信頼性を高めることができる。

[0021] 上記粘度比(η_1/η_{10})の上限は特に限定されないが、上記粘度比(η_1/η_{10})は好ましくは5以下である。

[0022] 以下、本発明に係る感光性組成物に含まれている各成分の詳細を説明する。

[0023] (重合性重合体(A))

上記重合性重合体(A)はカルボキシル基を有する。カルボキシル基を有する重合性重合体(A)は重合性を有し、重合可能である。上記重合性重合体(A)がカルボキシル基を有することで、感光性組成物の現像性が良好になる。上記重合性重合体(A)としては、例えば、カルボキシル基を有するアクリル樹脂、カルボキシル基を有するエポキシ樹脂及びカルボキシル基を有するオレフィン樹脂が挙げられる。なお、「樹脂」は、固形樹脂に限定さ

れず、液状樹脂及びオリゴマーも含む。

[0024] 上記重合性重合体（A）は、下記のカルボキシル基含有樹脂（a）～（e）であることが好ましい。

[0025] （a）不飽和カルボン酸と重合性不飽和二重結合を有する化合物との共重合によって得られるカルボキシル基含有樹脂

[0026] （b）カルボキシル基含有（メタ）アクリル共重合樹脂（b 1）と、1分子中にオキシラン環及びエチレン性重合性不飽和二重結合を有する化合物（b 2）との反応により得られるカルボキシル基含有樹脂

[0027] （c）1分子中にそれぞれ1個のエポキシ基及び重合性不飽和二重結合を有する化合物と、重合性不飽和二重結合を有する化合物との共重合体に、不飽和モノカルボン酸を反応させた後、生成した反応物の第2級の水酸基に飽和又は不飽和多塩基酸無水物を反応させて得られるカルボキシル基含有樹脂

[0028] （d）水酸基含有ポリマーに、飽和又は不飽和多塩基酸無水物を反応させた後、生成したカルボキシル基を有するポリマーに、1分子中にそれぞれ1個のエポキシ基及び重合性不飽和二重結合を有する化合物を反応させて得られる水酸基及びカルボキシル基含有樹脂

[0029] （e）芳香環を有するエポキシ化合物と飽和多塩基酸無水物又は不飽和多塩基酸無水物を反応させて得られる樹脂、又は芳香環を有するエポキシ化合物と不飽和二重結合を少なくとも1つ有するカルボキシル基含有化合物とを反応させた後、飽和多塩基酸無水物又は不飽和多塩基酸無水物をさらに反応させて得られる樹脂

[0030] 感光性組成物100重量%中、上記カルボキシル基を有する重合性重合体（A）の含有量は、好ましくは5重量%以上、より好ましくは10重量%以上、好ましくは50重量%以下、より好ましくは40重量%以下である。上記重合性重合体（A）の含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、感光性組成物の硬化性が良好になる。

[0031] （光重合開始剤（B））

本発明に係る感光性組成物は、光重合開始剤（B）を含むので、光の照射

により感光性組成物を硬化させることができる。光重合開始剤（B）は特に限定されない。光重合開始剤（B）は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。

[0032] 上記光重合開始剤（B）としては、例えば、アシルフォスフィンオキサイド、ハロメチル化トリアジン、ハロメチル化オキサジアゾール、イミダゾール、ベンゾイン、ベンゾインアルキルエーテル、アントラキノン、ベンズアンスロン、ベンゾフェノン、アセトフェノン、チオキサントン、安息香酸エステル、アクリジン、フェナジン、チタノセン、 α -アミノアルキルフェノン、オキシム、及びこれらの誘導体が挙げられる。上記光重合開始剤（B）は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。

[0033] 上記カルボキシル基を有する重合性重合体（A）100重量部に対して、上記光重合開始剤（B）の含有量は好ましくは0.1重量部以上、より好ましくは1重量部以上、好ましくは30重量部以下、より好ましくは15重量部以下である。上記光重合開始剤（B）の含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、感光性組成物の感光性をより一層高めることができる。

[0034] （酸化チタン（C））

本発明に係る感光性組成物は、酸化チタンを含むので、反射率が高いレジスト膜などの硬化物膜を形成できる。本発明に係る感光性組成物に含まれている酸化チタン（C）は特に限定されない。酸化チタン（C）は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。

[0035] 酸化チタン（C）を用いることによって、酸化チタン（C）以外の他の無機フィラーを用いた場合と比較して、反射率が高いレジスト膜を形成できる。

[0036] 上記酸化チタン（C）は、ルチル型酸化チタン又はアナターゼ型酸化チタンであることが好ましい。ルチル型酸化チタンの使用により、耐熱黄変性により一層優れたレジスト膜を形成できる。上記アナターゼ型酸化チタンは、ルチル型酸化チタンよりも、硬度が低い。このため、アナターゼ型酸化チタンの使用により、レジスト膜の加工性を高めることができる。

[0037] 上記酸化チタン（C）は、ケイ素酸化物又はシリコン化合物により表面処理されたルチル型酸化チタンを含むことが好ましい。上記酸化チタン（C）100重量%中、上記ケイ素酸化物又はシリコン化合物により表面処理されたルチル型酸化チタンの含有量は好ましくは10重量%以上、より好ましくは30重量%以上、好ましくは100重量%以下である。上記酸化チタン（C）の全量が、上記ケイ素酸化物又はシリコン化合物により表面処理されたルチル型酸化チタンであってもよい。上記ケイ素酸化物又はシリコン化合物により表面処理されたルチル型酸化チタンの使用により、レジスト膜の耐熱黄変性をより一層高めることができる。

[0038] ケイ素酸化物又はシリコン化合物により表面処理されたルチル型酸化チタンとしては、例えば、ルチル塩素法酸化チタンである石原産業社製の品番：CR-90や、ルチル硫酸法酸化チタンである石原産業社製の品番：R-550等が挙げられる。

[0039] 本発明に係る感光性組成物100重量%中、酸化チタン（C）の含有量は、好ましくは3重量%以上、より好ましくは10重量%以上、更に好ましくは15重量%以上、好ましくは80重量%以下、より好ましくは75重量%以下、更に好ましくは70重量%以下である。酸化チタン（C）の含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、レジスト膜が高温に晒されたときに、黄変し難くなる。さらに、塗工に適した粘度を有する感光性組成物を容易に調製できる。

[0040] （シリカ（D））

本発明に係る感光性組成物は、シリカ（D）として、第1のシリカ（D1）と、第2のシリカ（D2）とを含む。上記第1のシリカ（D1）の一次粒径は5nm以上、100nm以下である。上記第2のシリカ（D2）の一次粒径は0.5 μ m以上、10 μ m以下である。上記第1、第2のシリカ（D1）、（D2）はいずれも、シリカ粒子である。上記第1、第2のシリカ（D1）、（D2）は、後述するポリジメチルシロキサン（E）とは異なる。本発明に係る感光性組成物では、上記第1、第2のシリカ（D1）、（D2）

）は、上記ポリジメチルシロキサン（E）とは別に配合されている。

[0041] 上記第1，第2のシリカ（D1），（D2）の一次粒径は、レーザー回折法を用いて、粉体粒度を測定することにより測定された値である。

[0042] 特定の一次粒径を有する上記第1，第2のシリカ（D1），（D2）の双方を用いることは、感光性組成物の消泡性及びハジキ特性の向上に大きく寄与する。また、粒子径が比較的小さい上記第1のシリカ（D1）を用いることで、上記粘度比（ η_1 / η_{10} ）を1.1以上にすることが容易になる。

[0043] 本発明に係る感光性組成物100重量%中、上記第1，第2のシリカ（D1），（D2）の合計の含有量は、好ましくは3重量%以上、より好ましくは5重量%以上、好ましくは50重量%以下、より好ましくは40重量%以下である。上記第1，第2のシリカ（D1），（D2）の合計の含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、感光性組成物の消泡性及びハジキ特性がより一層良好になる。

[0044] 上記感光性組成物100重量%中の上記第1のシリカ（D1）の含有量（重量%）をC1とし、上記感光性組成物100重量%中の上記第2のシリカ（D2）の含有量（重量%）をC2としたときに、含有量比（ $C1 / C2$ ）は好ましくは0.1以上、好ましくは1以下である。上記含有量比（ $C1 / C2$ ）が上記下限以上及び上記上限以下であると、感光性組成物の消泡性及びハジキ特性がより一層良好になる。

[0045] （ポリジメチルシロキサン（E））

本発明に係る感光性組成物が、ポリジメチルシロキサン（E）を含むことにより、感光性組成物の消泡性及びハジキ特性が良好になる。上記ポリジメチルシロキサン（E）は特に限定されない。上記ポリジメチルシロキサン（E）は、上記第1，第2のシリカ（D1），（D2）とは異なる。本発明に係る感光性組成物では、上記ポリジメチルシロキサン（E）は、上記第1，第2のシリカ（D1），（D2）とは別に配合されている。上記ポリジメチルシロキサン（E）は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。

[0046] 本発明に係る感光性組成物 100 重量%中、上記ポリジメチルシロキサン (E) の含有量は、好ましくは 0.1 重量%以上、より好ましくは 0.3 重量%以上、好ましくは 5 重量%以下、より好ましくは 3 重量%以下である。上記ポリジメチルシロキサン (E) の含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、感光性組成物の消泡性及びハジキ特性がより一層良好になる。

[0047] (他の成分)

硬化性をより一層高めるために、本発明に係る感光性組成物は、カルボキシル基を有する重合性重合体 (A) とは異なる成分として、重合性単量体を含むことが好ましい。本発明に係る感光性組成物は、カルボキシル基を有する重合性重合体 (A) と重合性単量体との双方を含むことが好ましい。上記重合性単量体は重合性を有し、重合可能である。上記重合性単量体は特に限定されない。上記重合性単量体は、1 種のみが用いられてもよく、2 種以上が併用されてもよい。

[0048] 上記重合性単量体における重合性不飽和基としては、例えば、(メタ) アクリロイル基及びビニルエーテル基などの重合性不飽和二重結合を有する官能基が挙げられる。中でも、レジスト膜の架橋密度を高めることができるため、(メタ) アクリロイル基が好ましい。

[0049] 上記重合性不飽和基含有単量体は、(メタ) アクリロイル基を有する化合物であることが好ましい。上記 (メタ) アクリロイル基を有する化合物としては、エチレングリコール、メトキシテトラエチレングリコール、ポリエチレングリコールもしくはプロピレングリコールなどのグリコールのジ (メタ) アクリレート変性物や、多価アルコール、多価アルコールのエチレンオキサイド付加物もしくは多価アルコールのプロピレンオキサイド付加物の多価 (メタ) アクリレート変性物や、フェノール、フェノールのエチレンオキサイド付加物もしくはフェノールのプロピレンオキサイド付加物の (メタ) アクリレート変性物や、グルセリンジグリシジルエーテルもしくはトリメチロールプロパントリグリシジルエーテルなどのグリシジルエーテルの (メタ) アクリレート変性物や、メラミン (メタ) アクリレートが挙げられる。

- [0050] 上記多価アルコールとしては、例えば、ヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール及びトリスーヒドロキシエチルイソシアヌレートが挙げられる。上記フェノールの（メタ）アクリレートとしては、例えば、フェノキシ（メタ）アクリレート及びビスフェノールAのジ（メタ）アクリレート変性物が挙げられる。
- [0051] 「（メタ）アクリロイル」は、アクリロイルとメタクリロイルとを意味する。「（メタ）アクリル」は、アクリルとメタクリルとを意味する。「（メタ）アクリレート」は、アクリレートとメタクリレートとを意味する。
- [0052] 上記重合性単量体が含まれる場合には、該重合性単量体と上記カルボキシル基を有する重合性重合体（A）との合計100重量%中、上記重合性単量体の含有量は好ましくは5重量%以上、好ましくは50重量%以下である。上記重合性単量体の含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、感光性組成物を十分に硬化させることができる。さらに、レジスト膜の架橋密度が適度になり、十分な解像度を得ることができ、かつレジスト膜が黄変しにくくなる。
- [0053] レジスト膜の切り出し加工性を高めるために、感光性組成物は、環状エーテル骨格を有する化合物を含むことが好ましい。また、上記環状エーテル骨格を有する化合物の使用により、感光性組成物の硬化性も良好になる。
- [0054] 上記環状エーテル骨格を有する化合物としては、例えば、ビスフェノールS型エポキシ樹脂、ジグリシジルフタレート樹脂、トリグリシジルイソシアヌレートなどの複素環式エポキシ樹脂、ビキシレノール型エポキシ樹脂、ビスフェノール型エポキシ樹脂、テトラグリシジルキシレノイルエタン樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、水添ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型樹脂、臭素化ビスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、ビスフェノールAのノボラック型エポキシ樹脂、キレート型エポキシ樹脂、グリオキサール型エポキシ樹脂、アミノ基含有エポキシ樹脂、ゴム変性エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエンフェノリック型エポキシ

樹脂、シリコン変性エポキシ樹脂及び ϵ -カプロラクトン変性エポキシ樹脂が挙げられる。上記環状エーテル骨格を有する化合物は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。

[0055] 環状エーテル骨格を有する化合物は、重合性重合体（A）が有するカルボキシル基と反応して、感光性組成物を硬化させるように作用する。

[0056] 重合性重合体（A）100重量部に対して、上記環状エーテル骨格を有する化合物の含有量は好ましくは0.1重量部以上、より好ましくは1重量部以上、好ましくは50重量部以下、より好ましくは30重量部以下である。上記環状エーテル骨格を有する化合物の含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、レジスト膜の電気絶縁性をより一層高めることができる。

[0057] 高温に晒されたときにソルダーレジスト膜が黄変するおそれを小さくするために、本発明に係る感光性組成物は、酸化防止剤を含有することが好ましい。上記酸化防止剤は、ルイス塩基性部位を有することが好ましい。レジスト膜の黄変をより一層抑制する観点からは、上記酸化防止剤は、フェノール系酸化防止剤、リン系酸化防止剤及びアミン系酸化防止剤からなる群から選択された少なくとも1種であることが好ましい。レジスト膜の黄変をさらに一層抑制する観点からは、上記酸化防止剤は、フェノール系酸化防止剤であることが好ましい。すなわち、本発明に係る感光性組成物は、フェノール系酸化防止剤を含むことが好ましい。また、上記酸化防止剤として、フェノール系酸化防止剤を用いた場合には、フェノール系酸化防止剤以外の酸化防止剤を用いた場合と比較して、感光性組成物の消泡性及びハジキ特性の双方がより一層良好になる。

[0058] 上記フェノール系酸化防止剤の市販品としては、IRGANOX 1010、IRGANOX 1035、IRGANOX 1076、IRGANOX 1135、IRGANOX 245、IRGANOX 259、及びIRGANOX 295（以上、いずれもチバジャパン社製）、アデカスタブ AO-30、アデカスタブ AO-40、アデカスタブ AO-50、アデカスタブ AO-60、アデカスタブ AO-70、アデカスタブ AO

ー 80、アデカスタブ AO-90、及びアデカスタブ AO-330（以上、いずれもADEKA社製）、Sumilizer GA-80、Sumilizer MDP-S、Sumilizer BBM-S、Sumilizer GM、Sumilizer GS (F)、及びSumilizer GP（以上、いずれも住友化学工業社製）、HOSTANOX O10、HOSTANOX O16、HOSTANOX O14、及びHOSTANOX O3（以上、いずれもクラリアント社製）、アンテージ BHT、アンテージ W-300、アンテージ W-400、及びアンテージ W500（以上、いずれも川口化学工業社製）、並びにSEENOX 224M、及びSEENOX 326M（以上、いずれもシプロ化成社製）等が挙げられる。

[0059] 上記リン系酸化防止剤としては、シクロヘキシルフォスフィン及びトリフェニルフォスフィン等が挙げられる。上記リン系酸化防止剤の市販品としては、アデアスタブ PEP-4C、アデアスタブ PEP-8、アデアスタブ PEP-24G、アデアスタブ PEP-36、アデアスタブ HP-10、アデアスタブ 2112、アデアスタブ 260、アデアスタブ 522A、アデアスタブ 1178、アデアスタブ 1500、アデアスタブ C、アデアスタブ 135A、アデアスタブ 3010、及びアデアスタブ TPP（以上、いずれもADEKA社製）、サンドスタブ P-EPQ、及びホスタノックス PAR24（以上、いずれもクラリアント社製）、並びにJP-312L、JP-318-O、JPM-308、JPM-313、JPP-613M、JPP-31、JPP-2000PT、及びJPH-3800（以上、いずれも城北化学工業社製）等が挙げられる。

[0060] 上記アミン系酸化防止剤としては、トリエチルアミン、ジシアンジアミド、メラミン、エチルジアミノーS-トリアジン、2,4-ジアミノーS-トリアジン、2,4-ジアミノー6-トリル-トリアジン、2,4-ジアミノー6-キシリル-トリアジン及び第四級アンモニウム塩誘導体等が挙げられる。

- [0061] 上記カルボキシル基を有する重合性重合体（A）100重量部に対して、上記酸化防止剤の含有量は好ましくは0.1重量部以上、より好ましくは5重量部以上、好ましくは30重量部以下、より好ましくは15重量部以下である。上記酸化防止剤の含有量が上記下限以上及び上限以下であると、耐熱黄変性により一層優れたレジスト膜を形成できる。
- [0062] 本発明に係る感光性組成物は、溶剤を含有してもよい。溶剤の双極子モーメントは1 Debye以上であることが好ましい。双極子モーメントが1 Debye以上である溶剤の使用により、ポットライフに優れた感光組成物を提供できる。
- [0063] また、本発明に係る感光性組成物は、着色剤、充填剤、硬化剤、硬化促進剤、離型剤、表面処理剤、難燃剤、粘度調節剤、分散剤、分散助剤、表面改質剤、可塑剤、抗菌剤、防黴剤、レベリング剤、安定剤、カップリング剤、タレ防止剤又は蛍光体等を含んでいてもよい。
- [0064] さらに、本発明に係る感光性組成物は、第1の液と、第2の液とを有し、該第1、第2の液が混合されて用いられる2液混合型の感光性組成物であってもよい。2液混合型の感光性組成物の場合には、使用前に重合又は硬化反応が進行するのを抑制できる。このため、2液それぞれのポットライフを向上できる。また、本発明に係る感光性組成物は、第1の液のみを有する1液型の感光性組成物であってもよい。本発明に係る感光性組成物には、1液型の感光性組成物と2液混合型などの多液混合型の感光性組成物が含まれる。
- [0065] 2液混合型の感光性組成物の場合には、重合性重合体（A）と光重合開始剤（B）と酸化チタン（C）と第1のシリカ（D1）と第2のシリカ（D2）とポリジメチルシロキサン（E）とはそれぞれ、上記第1の液及び上記第2の液の内の少なくとも一方に含まれる。また、上記重合性単量体、上記環状エーテル骨格を有する化合物及び上記酸化防止剤が含まれる場合には、上記重合性単量体、上記環状エーテル骨格を有する化合物及び上記酸化防止剤はそれぞれ、上記第1の液及び上記第2の液の内の少なくとも一方に含まれる。

る。

[0066] 上記第1, 第2の液が混合された混合物は、感光性組成物であり、重合性重合体(A)と光重合開始剤(B)と酸化チタン(C)と第1のシリカ(D1)と第2のシリカ(D2)とポリジメチルシロキサン(E)とを含む。

[0067] 本発明に係る感光性組成物は、例えば、各配合成分を攪拌混合した後、3本ロールにて均一に混合することにより調製できる。

[0068] 感光性組成物を硬化させるために用いられる光源としては、紫外線又は可視光線等の活性エネルギー線を発光する照射装置が挙げられる。上記光源としては、例えば、超高圧水銀灯、D e e p U V ランプ、高圧水銀灯、低圧水銀灯、メタルハライドランプ及びエキシマレーザーが挙げられる。これらの光源は、感光性組成物の構成成分の感光波長に応じて適宜選択される。光の照射エネルギーは、所望とする膜厚又は感光性組成物の構成成分により適宜選択される。光の照射エネルギーは、一般に、 $10 \sim 3000 \text{ mJ} / \text{cm}^2$ の範囲内である。

[0069] (LEDデバイス)

本発明に係る感光性組成物は、LEDデバイスのレジスト膜を形成するために好適に用いられ、ソルダーレジスト膜を形成するためにより好適に用いられる。本発明に係る感光性組成物は、レジスト組成物であることが好ましく、ソルダーレジスト組成物であることが好ましい。

[0070] 本発明に係るプリント配線板は、回路を表面に有するプリント配線板本体と、該プリント配線板本体の上記回路が設けられた表面に積層されたソルダーレジスト膜とを備える。該ソルダーレジスト膜が、本発明に係る感光性組成物により形成されている。

[0071] 図1に、本発明の一実施形態に係る感光性組成物を用いて形成されたソルダーレジスト膜を有するLEDデバイスの一例を模式的に部分切欠正面断面図で示す。

[0072] 図1に示すLEDデバイス1では、基板2の上面2aに、感光性組成物により形成されたレジスト膜3が積層されている。レジスト膜3は、パターン

膜である。よって、基板2の上面2aの一部の領域では、レジスト膜3は形成されていない。レジスト膜3が形成されていない部分の基板2の上面2aには、電極4a, 4bが設けられている。基板2は、プリント配線板本体であることが好ましい。

[0073] レジスト膜3の上面3aに、LEDチップ7が積層されている。レジスト膜3を介して、基板2上にLEDチップ7が積層されている。LEDチップ7の下面7aの外周縁には、端子8a, 8bが設けられている。はんだ9a, 9bにより、端子8a, 8bが電極4a, 4bと電氣的に接続されている。この電氣的な接続により、LEDチップ7に電力を供給できる。

[0074] 以下、本発明の具体的な実施例及び比較例を挙げることにより、本発明を明らかにする。本発明は以下の実施例に限定されない。

[0075] 実施例及び比較例では、以下の材料1)～15)を用いた。

[0076] 1) アクリルポリマー1 (カルボキシル基を有する重合性重合体、下記合成例1で得られたアクリルポリマー1)

[0077] (合成例1)

温度計、攪拌機、滴下ロート及び還流冷却器を備えたフラスコに、溶剤であるエチルカルビトールアセテートと、触媒であるアゾビスイソブチロニトリルとを入れ、窒素雰囲気下で80℃に加熱し、メタクリル酸とメチルメタクリレートとを30:70のモル比で混合したモノマーを2時間かけて滴下した。滴下後、1時間攪拌し、温度を120℃に上げた。その後、冷却した。得られた樹脂の全てのモノマー単位の総量のモル量に対するモル比が10となる量のグリシジルアクリレートを加え、触媒として臭化テトラブチルアンモニウムを用い100℃で30時間加熱して、グリシジルアクリレートとカルボキシル基とを付加反応させた。冷却後、フラスコから取り出して、固形分酸価60mg KOH/g、重量平均分子量15000、二重結合当量1000のカルボキシル基含有樹脂を50重量% (不揮発分) 含む溶液を得た。以下、この溶液をアクリルポリマー1と呼ぶ。

[0078] 2) DPHA (アクリルモノマー、ジペンタエリスリトールヘキサアクリ

レート、比重 1. 1)

3) TPO (光ラジカル発生剤である光重合開始剤、BASF ジャパン社製)

4) 828 (ビスフェノール A 型エポキシ樹脂、三菱化学社製、比重 1. 2)

5) CR-50 (酸化チタン、石原産業社製、塩素法により製造されたルチル型酸化チタン)

6) R202 (シリカ、日本アエロジル社製、一次粒径 14 nm)

7) RX50 (シリカ、日本アエロジル社製、一次粒径 40 nm)

8) 5X (シリカ、龍森社製、一次粒径 1. 5 μ m)

9) VX-S (シリカ、龍森社製、一次粒径 4 μ m)

10) AA (シリカ、龍森社製、一次粒径 6 μ m)

11) KF-96 (ポリジメチルシロキサン、信越化学工業社製)

12) KS-7710 (コンパウンド型シリコンオイル、ポリジメチルシロキサン、信越化学工業社製)

13) IRGANOX 1010 (フェノール系酸化防止剤、チバジャパン社製)

14) IRGAFOS 168 (リン系酸化防止剤、チバジャパン社製)

15) エチルカルビトールアセテート (溶剤、双極子モーメント 1 Debye 以上、比重 1. 0)

[0079] (実施例 1)

合成例 1 で得られたアクリルポリマー 1 を 15 重量部と、DPHA (ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート) 5 重量部と、TPO (光ラジカル発生剤である光重合開始剤、BASF ジャパン社製) 2 重量部と、828 (ビスフェノール A 型エポキシ樹脂、三菱化学社製) 8 重量部と、CR-50 (酸化チタン、石原産業社製) 40 重量部と、R202 (シリカ、日本アエロジル社製、一次粒径 14 nm) 3 重量部と、VX-S (シリカ、龍森社製、一次粒径 4 μ m) 15 重量部と、KS-7710 (コンパウンド型シリコ

ーンオイル、ポリジメチルシロキサン、信越化学工業社製）１重量部と、エチルカルビトールアセテート３０重量部とを配合し、混合機（練太郎ＳＰ－５００、シンキー社製）にて３分間混合した後、３本ロールにて混合し、混合物を得た。その後、ＳＰ－５００を用いて、得られた混合物を３分間脱泡することにより、感光性組成物であるレジスト材料を得た。

[0080] （実施例２～１０及び比較例１～３）

使用した材料の種類及び配合量を下記の表１に示すように変更したこと以外は、実施例１と同様にして、レジスト材料を得た。

[0081] （評価）

（１）粘度

粘度計（東機産業社製「ＴＶＥ２２Ｌ」）を用いて、得られたレジスト材料のせん断速度１ｒｐｍにおける２５℃での粘度 η_1 （ｍＰａ・ｓ）と、せん断速度１０ｒｐｍにおける２５℃での粘度を η_{10} （ｍＰａ・ｓ）とを測定した。

[0082] （２）消泡性

表面に銅箔が貼り付けられている１００ｍｍ×１００ｍｍのＦＲ－４基板を用意した。また、得られたレジスト材料を５０回手で攪拌した。攪拌直後のレジスト材料を、上記ＦＲ－４基板の銅箔が貼り付けられている面に、スクリーン印刷により塗布して、レジスト材料層を形成した。その後、室温（２５℃）で１分間放置した後、印刷された１００ｍｍ×１００ｍｍの領域のレジスト材料層中において、直径０．５ｍｍ以上の泡が存在するか否かを目視により観察した。泡の個数に応じて、レジスト材料（感光性組成物）の消泡性を下記の基準で判定した。

[0083] [消泡性の判定基準]

〇〇：泡が確認されない

○：泡が１～２０個確認された

×：泡が２１個以上確認された

[0084] （３）ハジキ特性

上記（２）消泡性の評価に用いたＦＲ－４基板の銅箔が貼り付けられている面に、離型フィルムであるＰＥＴフィルムを貼り付けた。また、得られたレジスト材料を５０回手動で攪拌した。攪拌直後のレジスト材料を、上記ＦＲ－４基板上のＰＥＴフィルム上に、スクリーン印刷により印刷して、レジスト材料層を形成した。印刷後、室温（２５℃）で１時間放置し、レジスト材料層のＰＥＴフィルムの表面に対するハジキの状態を目視により確認した。すなわち、印刷領域の端縁から、外側に広がっている場合、又は端縁から外側にレジスト材料の液滴が分離している場合、ハジキが生じているとみなした。このハジキの状態について、上記印刷領域の端縁から外側に広がっているレジスト材料層の最外側端縁までの距離、又は上記印刷領域の端縁から外側に位置しているレジスト材料液滴までの距離をハジキ距離とした。ハジキ特性を、以下の３段階の基準で判定した。

[0085] [ハジキ特性の判定基準]

〇〇：ハジキ距離が１０ｍｍ未満

〇：ハジキ距離が１０ｍｍ以上、２０ｍｍ未満

×：ハジキ距離が２０ｍｍ以上

[0086] 結果を下記の表１に示す。なお、下記の表１において、粘度比（ η_1 / η_{10} ）は、せん断速度１ｒｐｍにおける２５℃での粘度 η_1 （ $\text{mPa} \cdot \text{s}$ ）の、せん断速度１０ｒｐｍにおける２５℃での粘度 η_{10} （ $\text{mPa} \cdot \text{s}$ ）に対する比を示す。また、下記の表１において、含有量比（ C_1 / C_2 ）は、感光性組成物１００重量％中の第１のシリカの含有量（重量％） C_1 の、感光性組成物１００重量％中の第２のシリカの含有量（重量％） C_2 に対する比を示す。

[0087]

[表1]

		実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6	実施例 7	実施例 8	実施例 9	実施例 10	比較例 1	比較例 2	比較例 3
配合成分(重量部)	アクリルポリマー	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	アクリルモノマー	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	光重合開始剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	エポキシ樹脂	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	酸化チタン	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	シリカ	3	3	3	3	8	1	10		3	3		3	3
									3					
											15			
		15	15	15	15	10	20	7	15			15		15
										15				
	ポリジメチルシロキサン		1	1	1							1	1	
	フェノール系酸化防止剤	1				1	1	1	1	1	1			
	リン系酸化防止剤			1										
	溶剤				1									
	エチルカルビトールアセテート	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	粘度比($\eta 1/\eta 10$)	1.30	1.25	1.31	1.24	1.45	1.15	1.62	1.23	1.32	1.41	1.04	1.09	1.26
	含有量比(C1/C2)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	0.05	1.43	0.20	0.20	0.20	-	-	0.20
	消泡性	〇〇	〇	〇〇	〇	〇〇	〇〇	〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇	〇	x
	ハジキ特性	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	x	x	〇〇

符号の説明

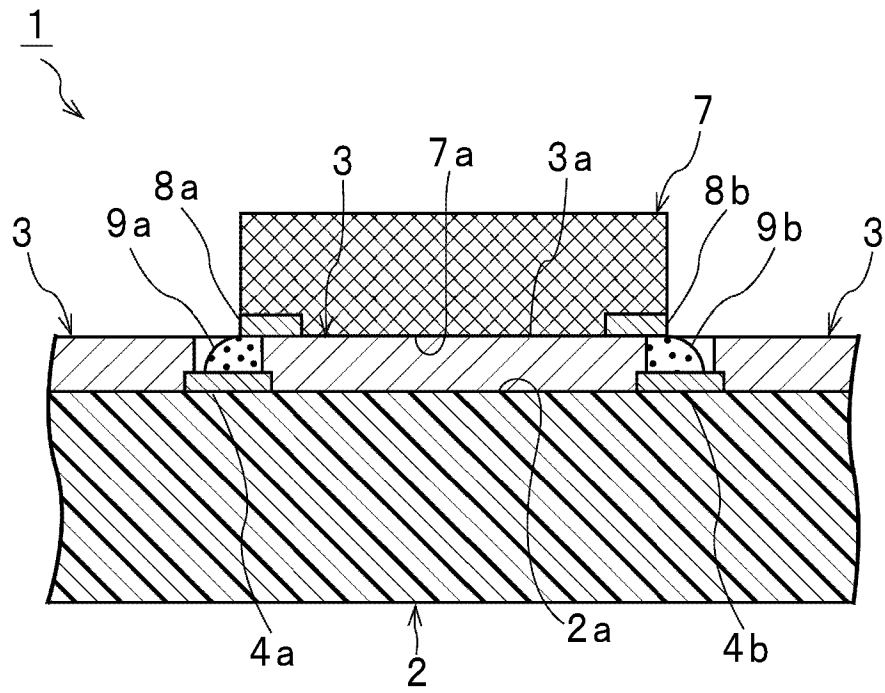
- [0088] 1…LEDデバイス
2…基板
2 a…上面
3…レジスト膜
3 a…上面
4 a, 4 b…電極
7…LEDチップ
7 a…下面
8 a, 8 b…端子
9 a, 9 b…はんだ

請求の範囲

- [請求項1] カルボキシル基を有する重合性重合体と、光重合開始剤と、酸化チタンと、第1のシリカと、第2のシリカと、ポリジメチルシロキサンとを含み、
- 前記第1のシリカの一次粒径が5 nm以上、100 nm以下であり、
- 、
- 前記第2のシリカの一次粒径が0.5 μm以上、10 μm以下であり、
- せん断速度1 rpmにおける25℃での粘度 (mPa・s) を η_1 とし、せん断速度10 rpmにおける25℃での粘度 (mPa・s) を η_{10} としたときに、粘度比 (η_1 / η_{10}) が1.1以上である、感光性組成物。
- [請求項2] フェノール系酸化防止剤をさらに含む、請求項1に記載の感光性組成物。
- [請求項3] 感光性組成物100重量%中の前記第1のシリカの含有量 (重量%) をC1とし、感光性組成物100重量%中の前記第2のシリカの含有量 (重量%) をC2としたときに、含有量比 (C1 / C2) が0.1以上、1以下である、請求項1に記載の感光性組成物。
- [請求項4] フェノール系酸化防止剤をさらに含む、
- 感光性組成物100重量%中の前記第1のシリカの含有量 (重量%) をC1とし、感光性組成物100重量%中の前記第2のシリカの含有量 (重量%) をC2としたときに、含有量比 (C1 / C2) が0.1以上、1以下である、請求項1に記載の感光性組成物。
- [請求項5] ソルダーレジスト組成物である、請求項1～4のいずれか1項に記載の感光性組成物。
- [請求項6] 回路を表面に有するプリント配線板本体と、該プリント配線板本体の回路が設けられた表面に積層されたソルダーレジスト膜とを備え、前記ソルダーレジスト膜が請求項1～4のいずれか1項に記載の感光

性組成物を用いて形成されている、プリント配線板。

[図1]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/064778

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G03F7/004(2006.01)i, G03F7/075(2006.01)i, H05K3/28(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G03F7/004, G03F7/075, H05K3/28

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2011
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2011	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2011

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2010-266556 A (Tamura Corp.), 25 November 2010 (25.11.2010), (Family: none)	1-6
A	JP 2007-322546 A (Taiyo Ink Manufacturing Co., Ltd.), 13 December 2007 (13.12.2007), & CN 101082773 A & JP 4340272 B2	1-6
A	JP 2007-199491 A (Showa Denko Kabushiki Kaisha), 09 August 2007 (09.08.2007), (Family: none)	1-6

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
21 July, 2011 (21.07.11)

Date of mailing of the international search report
02 August, 2011 (02.08.11)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/064778

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 06-180499 A (Matsushita Electric Works, Ltd.), 28 June 1994 (28.06.1994), & JP 2746031 B2	1-6
A	JP 2007-310201 A (Kaneka Corp.), 29 November 2007 (29.11.2007), (Family: none)	1-6

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. G03F7/004(2006.01)i, G03F7/075(2006.01)i, H05K3/28(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. G03F7/004, G03F7/075, H05K3/28

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 1 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 1 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 1 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2010-266556 A（株式会社タムラ製作所）2010. 11. 25, （ファミリーなし）	1 - 6
A	JP 2007-322546 A（太陽インキ製造株式会社）2007. 12. 13, & CN 101082773 A & JP 4340272 B2	1 - 6
A	JP 2007-199491 A（昭和電工株式会社）2007. 08. 09, （ファミリーなし）	1 - 6

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

2 1 . 0 7 . 2 0 1 1

国際調査報告の発送日

0 2 . 0 8 . 2 0 1 1

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

外川 敬之

2 H

3 7 1 8

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 2 3 1

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 06-180499 A (松下電工株式会社) 1994. 06. 28, & JP 2746031 B2	1 - 6
A	JP 2007-310201 A (株式会社カネカ) 2007. 11. 29, (ファミリーなし)	1 - 6